In ドープ MgO 薄膜の発光特性

Emission Property of In Doped MgO Films

工学院大¹, 才一ク製作所², 都産技研³, 京都大⁴, °高坂 亘¹, 小川 広太郎^{2,1}, 松田 真樹¹, 日下 皓也¹, 太田 優一³, 金子 健太郎⁴, 山口 智広¹, 本田 徹¹, 藤田 静雄⁴, 尾沼 猛儀¹ Kogakuin Univ.¹, ORC Manufacturing Co., Ltd.², TIRI³, Kyoto Univ.⁴, °W. Kosaka¹, K. Ogawa^{2,1}, M. Matsuda¹, H. Kusaka¹, Y. Ota³, K. Kaneko⁴, T. Yamaguchi¹, T. Honda¹, S. Fujita⁴ and T. Onuma¹ E-mail: cm²1022@ns.kogakuin.ac.jp

岩塩構造酸化マグネシウム亜鉛(RS-Mg_xZn_{1-x}O)は、サブ 200 nm 域の半導体発光材料として期待される[1,2]。MgO 薄膜は室温で 166 nm 付近にバンド端付近(NBE)の発光を示すが[3]、Zn を 5%程度混晶化させると 205 nm 付近へと急激に長波長シフトする[1,2]。そこで、Zn 組成を 1%以下に減らした Zn ドープ MgO 薄膜を成長した。すると、極低温であるが、170 nm 付近に NBE 発光が現れることが分かった[4]。しかし、6.2 eV 付近に深い準位が関与するブロードな発光帯が支配的に現れた。この発光起源には、Mg 空孔(V_{Mg})が関与すると報告されているが[5]、その詳細は明らかになっていない。仮に Mg 空孔であればアクセプター型欠陥であるため、ドナー不純物ドープにより欠陥密度が変化すると予測される。そこで本研究では、ドナー不純物として 3 価の陽イオンである In を MgO にドープした薄膜の発光特性を調査し、特に 6.2 eV 付近の発光帯の振舞いを明らかにすることを目的とした。

ミスト CVD 法により MgO(100)基板上へ In ドープ MgO の結晶成長を行った。成長温度は 700 ℃、成長時間は 2 時間とし、前駆体溶液の In ドープ量を 0.2~1.8 mol%と変化させた。膜厚は 300~850 nm 程であった。 VUV 域の CL 測定では、光路を窒素で置換した VUV 分光システムを用いた[3]。

図1に6KでのCLスペクトルの比較を示す。MgOホ モエピタキシャル薄膜では、7.63 eV に NBE 発光を観 測した他、6.2 eV、5.3 eV 付近に深い準位が関与する 発光帯が現れた。上述のとおり、後者 2 つは V_{Mg} 由来 の V センターが関与すると報告されている[5]。Zn ド ープ薄膜では、MgO の NBE 発光ピークが残るもの の、7.2 eV付近にNBE発光のショルダーを観測した。 発光起源として、Zn ドープにより形成されたアイソ エレクトロニックトラップへの正孔の捕獲が挙げら れる[4]。一方、0.2 mol%の In ドープ薄膜では NBE 発 光は観測されず、6.2 eV 付近の発光帯と低エネルギー 側の発光が現れた。In をドープすることにより補償欠 陥が形成され、点欠陥またはその複合欠陥への正孔 の捕獲が優先的となり NBE 発光が観測されなくなっ たと考えられる。In ドープ量を 0.9~1.8 mol%へと増 加させると、6.2 eV 付近の発光帯の強度は減少した。

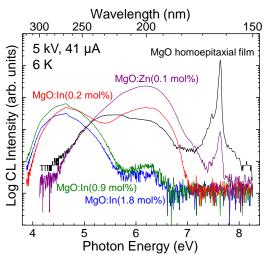


Fig. 1. CL spectra of MgO homoepitaxial film, Zn doped MgO film and In doped MgO films at 6 K.

In による V_{Mg} の置換などが考えられるが、詳細はさらに検討する必要がある。以上より、6.2~eV 付近の発光帯の強度は、In ドナー不純物のドープにより変化し、 V_{Mg} やその複合欠陥などが関与することが示唆された。

本研究の一部は科研費(20H00246、22K04952)及び工学院大学総合研究所プロジェクト研究の援助を受けた。本研究の一部は、工学院大学、京都大学、(株)オーク製作所の共同研究の一環として行われた。

[1] K. Ishii et al., Appl. Phys. Express **12**, 052011 (2019). [2] T. Onuma et al., Appl. Phys. Lett. **113**, 061903 (2018). [3] T. Onuma et al., Appl. Phys. Lett. **119**, 132105 (2021). [4] 高坂他,第 82 回応用物理学会秋季学術講演会,12p-N206-17. (2021). [5] R. T. Williams et al., Phys. Rev. B **20**, 1687 (1979). [6] P. Rinke et al., Phys. Rev. Lett. **108**, 126404 (2012).